# تحسين الخواص السطحية لزرعات التيتانيوم Ti الطبية بتوضيع أغشية رقيقة من السليكون المسلك العضوى HMDSO

# أحمد محمد خضر $^1$ أ. د. محمد على سلامة $^2$ ، أ. د. مصطفى حسن الموالدي $^3$

أطالب دكتوراه – قسم هندسة التصميم الميكانيكي – كليّة الهندسة الميكانيكيّة والكهربائيّة – جامعة دمشق.

2أستاذ دكتور في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق.

أستاذ دكتور عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق.

#### الملخص

تاريخ الإيداع: 2022/6/10 تاريخ القبول: 2022/7/25



حقوق النشر: جامعة دمشق -سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04

جرى توضيع أغشية رقيقة من السليكون العضوي (سداسي ميثيل ديسيلوكسان المتبلمرة بلازمياً) (pp-HMDSO) على سطوح ركائز من زرعات التيتانيوم Ti الطبية باستخدام بلازمياً) (pECVD) على سطوح ركائز من زرعات التيتانيوم Ti الطبية باستخدام تقنية توضيع البخار الكيميائي المعزز بالبلازما (PECVD)، وجرى دراسة تأثير هذه الأغشية في كلٍ من: مقاومة التآكل لهذه الزرعات في وسط مخرَّش من محلول %0.9 NaCl، وقيم القساوة الميكروية المركبة لها. وبهدف تحليل مورفولوجية هذه الأغشية بمجهر القوة الذرية (Atomic Force Microscope (AFM) تم توضيعها على ركائز من السليكون، وبغية قياس ثخانة هذه الأغشية وضعت على مجاوب بلورة من مادة الكوارتز (Quartz Crystal Microbalance (QCM)، وذلك ضمن شروط التوضيع المحددة نفسها، وكما أجريت الاختبارات الكهروكيميائية باستخدام تقنية الاستقطاب (تاقل) لدراسة مقاومتها للتآكل الكهروكيميائي، وأُجريت اختبارات القساوة الميكروية على هذه الركائز والموضعة على سطوح زرعات التيتانيوم عشرة أيام في الوسط المخرش، أظهرت النتائج خواصاً واعدة للحماية من التآكل لأغشية السليكون العضوي pp-HMDSO المتبلمر بلازمياً الموضعة على سطوح زرعات التيتانيوم الطبية، اضافة الى ارتفاع ملحوظ في قيم القساوة الميكروية.

الكلمات المفتاحية: أغشية رقيقة، السليكون العضوي HMDSO، التآكل الكهروكيميائي، توضيع البخار الكيميائي المعزز بالبلازما PECVD، قساوة ميكروية، مجهر القوة الذرية، مجاوب بلورة من الكوارتز QCM.

ISSN:2789-6854 (online)

# Improving The Surface Properties Of Medical Titanium Implants By Deposited Organosilicon HMDSO

# Ahmad Mohamad Khder<sup>1</sup>, Prof. Mohamad Ali Salameh<sup>2</sup>, Prof. Moustafa Hasan Al-Mawaldi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Postgraduate student, Mechanical Design Engineering Department, Mechanical and Electric Engineering, Damascus University.

<sup>2</sup>Professor in Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

<sup>3</sup>Professor and Dean Mechanical and Electrical Engineering College, Damascus University.

#### **Abstract**

Organosilicon Thin films (plasma polymerized hexamethyldisiloxane) (pp-HMDSO) were deposited on substrate surfaces of medical Titanium implants using plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD), and was studied the effect of these films on each of Corrosion resistance to these implants in the middle of a script of a solution of 0.9% NaCl, and the values of the composed micro-hardness. With the aim of analyzing the morphological analysis of these films by Atomic Force Microscope (AFM) the films were deposited on silicon substrates, and to measure the thickness of these films they were deposited on a Quartz Crystal MicroBalance (QCM), within the same specified conditions for the settings themselves. Electrochemical tests were conducted using Tafel polarization technique to study film's corrosion resistance, and micro-hardness test was also performed on these substrates and reference samples, after immersion of the substrates (which were deposited with above mentioned thin films) for ten days in abrasive media. The results showed promising properties to protect from corrosion of the organosilicon (pp-HMDSO) thin films deposited on medical Tanium implant surface, in addition to increase the micro-hardness values.

**Keywords:** Thin Films, Organosilicon HMDSO, Electrochemical Corrosion, Plasma Enhancing Chemical Vaper Deposition PECVD, Micro-Hardness, Atomic Force Microscope (AFM), Quartz Crystal Microbalance QCM.

Received: 10/6/2022 Accepted: 25/7/2022



**Copyright:** Damascus University- Syria, The authors retain the copyright under a CC BY- NC-SA

#### 1- المقدمة:

تُستخدم تقنية توضيع البخار الكيميائي المعزز بالبلازما (PECVD) لتوضيع أغشية رقيقة على سطوح المواد وتحسين خواصها السطحية حسب التطبيقات المطلوبة من هذه المواد، وتُعدُّ هذه الطريقة إحدى أهم التطبيقات التقانية والصناعية الهامة للأغشية الرقيقة المتبلمرة بلازمياً، حيث تستخدم بشكل واسع لتحضير أغشية رقيقة شبه السليكونية (plasma polymers) للبوليميرات البلازمية (Si:Ox:Cv:Hz) العضوية المونوميرات علي المعتمدة السليكونية (organosilicon) مثل سداسي مثيل ثنائي ديسيلوكسان (CH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>-Si<sub>2</sub>-O). وُجِد أن هذه الأغشية ذات بنية لابلورية (amorphous) وخالية من الثقوب الإبرية (pinhole free) [3]، وتتمتع هذه الأغشية بخواص ميكانيكية جيدة [2-4]، ولهذه الأسباب يمكن توظيف هذه الأغشية في تطبيقات تقنية عديدة مثل استخدامها كأغشية مقاومة للخدش (scratch-resistant) [1]، كما ويمكن أن توضع هذه الأغشية على ركائز من السيراميك و السليكون [5-6].

تم التحقيق من قبل كلٍ من Mayer. Uwe Lommatzsch عام 2022 في البلمرة المشتركة بالبلازما مع السليكون العضوي (HMDSO) باستخدام والمُركب العضوي (limonene) باستخدام والمُركب العضوي (APPJ (atmospheric pressure plasma jet) هذه الدراسة أن البلمرة المشتركة مع APPJ تسمح بتجميع الأغشية مع مركبات وظيفية تتشأ من مادة عضوية organic ومادة غير عضوية (السليكون العضوي organic). تم العثور على معدل تدفق المركبات العضوية في المزيج لتكون فعًالة بهدف ضبط بنية الشبكة وكمية المجموعات الوظيفية ونوعيتها مثل بنية الشبكة وكمية المجموعات الوظيفية ونوعيتها مثل أهمية خاصة لتركيب الأغشية الرقيقة المرنة المتمتعة بخواص التصاق جيدة [7].

درس الباحث S.Saloum et al عام (2017)، خصائص الحماية من التآكل للأغشية الرقيقة من سداسي ميثيل الديسيلوكسان المتبلمر بلازمياً PP-HMDSO، حيث كانت الحماية جيدة بحدود 84% في محلول ملحي (0.3M NaCl)، وحصل الباحثون على حماية مقدارها بالنسبة للفولاذ المقاوم للصدأ SS316 المغطى بغشاء رقيق من سداسي ميثيل الديسيلوكسان المتبلمر بلازمياً -PP من سداسي ميثيل الديسيلوكسان المتبلمر بلازمياً -PP الأوساط المخرشة آنفة الذكر [8].

رُست خواص التآكل للأغشية الرقيقة الموضّعة على الفولاذ بواسطة PECVD في المزيج PECVD ضمن محلول PECVD أو]. وَجد كل من ضمن محلول 0.1M KCl [9]. وَجد كل من إلغشية الرقيقة الرقيقة الرقيقة المدى pp-HMDSO الأغشية الرقيقة الطويل عندما تتقادم في الهواء بعد التوضيع. وضعً كل من معدن Mater من معدن Pp-HNDSO [11] Yeong-Muetal من معدن Mater وأخرين [12] أغشيةً رقيقةً من المحاية من الباحثين Pp-HNDSO وأخرين [12] أغشيةً رقيقةً من -pp-HNDSO من أجل الحماية من الباحثين Abourayana, Zreiba وأخرون [13] خواص درس Abourayana, Zreiba

التآكل لمادة pp-HMDSO/benzene المُرسَّبة على سبيكة الألمنيوم 6061، وذلك في محلول NaCl %5. درس Angelini وآخرون [14] مقاومة التآكل للأغشية الرقيقة على الفولاذ في

الرقيقة pp-HMDSO/O<sub>2</sub> الموضعة على القولاد في محلول من كبريتات الصوديوم 0.1M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. سنقوم في هذا العمل بتوضيع أغشية رقيقة متبلمرة بلازمياً من السلكون العضوي HMDSO.

من السليكون العضوي HMDSO على ركازات مختلفة من معدن التيتانيوم Ti لدراسة خواص التآكل الكهروكيميائي والقساوة المكروية لهذه الأغشية، وعلى

السليكون لدراسة الخواص المورفولوجية وعلى بلورات الكوارتز لتقدير ثخانة هذه الأغشية.

# 2- الطرائق التجريبية:

pp- وضّعت الأغشية الرقيقة من السليكون العضوي -13.56 وضّعت الأعشية الرقيقة من السليكون التردد 13.56 (Plasma Consult GmbH HCD-L 300 MHz منخفض الضغط حيث بلغ الضغط الأولي System) وذلك في شروط التشغيل التالية:

- الاستطاعة الراديوية المطبقة تساوي 300 واط.
  - ◄ معدل تدفق HDMSO يساوي 12 sccm.
    - ◄ درجة حرارة المبخر °C.
    - زمن التوضيع 30 دقيقة .
    - ضغط التوضيع الكلى يساوى Pa.
      - تدفق غاز الأرغون 40 sccm.
        - تدفق غاز الهليوم 50 sccm.

يبين الشكل (1) الجهاز المستخدم من أجل عملية التوضع وتشخيص البلازما. يتألف المنبع HCD-L 300 من أنبوبين متمحورين بطول 30cm، حيث الأنبوب الداخلي هو المهبط المجوف والأنبوب الخارجي يُشكل المصعد، وكلا الأنبوبين مزودان بثقوب متمحورة و متراصفة مع بعضها منتجةً 30 نفاثاً بلازمياً (plasma jet). تطبق الاستطاعة الراديوية (300 واط كحد أعظم) عند 13.56MHz على المهبط. يتم تفريغ حجرة العمليات ذات الأبعاد(50 x 50 x 50 cm³)، وذلك قبل إجراء عملية التوضيع إلى ضغط أولى يساوى P=10<sup>-5</sup> mbar باستخدام مضخة أولية (Alcatel 2063 C2) ومضخة دوارة (Alcatel RSV 301B). يتكون نظام تبخير من مقياس تدفق سائل كتلى (Lintec-LM-2100A)، ومبخّر (Lintec-VU) مُسخّن إلى الدرجة 70°C. يُحمّل ببخار السليكون العضوى HMDSO إلى حجرة البلازما بغاز الهليوم، من خلال أنبوب مسخن إلى الدرجة 50°C. استخدمت غازات تجارية من الأرغون والهليوم بنقاوة (99.999%) ومادة HMDSO من شركة Aldrich وبنقاوة %98. وضّعت الأغشية على ركائز من

شرائح ميكروية من الكوارتز من أجل قياس ثخانة الغشاء الرقيق. تم وضع العينات على حامل ركازة، وعلى مسافة 4.5cm



الشكل (1) الجهاز المستخدم ومنظومة التوضيع الكيميائي للبخار الشكل (1) المعزز بلازمياً

جرى تنظيف جميع الركائز بالكحول والماء المقطر لضمان نظافة السطح من أية بقايا وأوساخ ودهون، وذلك قبل البدء في توضيع أغشية رقيقة من السليكون العضوي pp-HDMSO وبعد ذلك يتم التعامل مع العينات والحرص على عدم تلويثها ومسكها باليد.

استعملت طريقة الاستقراء تافل لاستناج قيم التآكل الكهروكيميائي لأغشية pp-HMDSO الموضعة على ركائز من التيتانيوم Ti بمنظومة اختبار وقياس التآكل الكهروكيميائي الموضحة في الشكل (a-2) والمكونة من جهاز iviumstat التحليل التآكل الشكل (b-2)، واستخدمت خلية تقليدية ثلاثية الأقطاب بسعة 300ml الشكل (c-2)، وخدت قياسات التآكل للعينات الشكل (d-2) بعد وضعها في وسط مكون من محلول ملحي (d-2) (d-2) بعد وضعها للسائل الفيزيولوجي)، حيث تم وضع هذه الرُكازات في المحلول لمدة 10 أيام وفي درجة حرارة الغرفة  $2^{\circ}$ C. المتنات تافل المتنتجت البارامترات الحدية  $1^{\circ}$ C.  $1^{\circ}$ C.  $1^{\circ}$ C. (Tafel plots)





الشكل (a (2) منظومة اختبار وقياس التآكل الكهروكيميائي (b جهاز iviumstat.xr لتحليل التآكل والخلية ثلاثية الأقطاب. c) خلية ثلاثية الأقطاب. d) العينات المختبرة. أجريت تجارب القساوة وحساب القساوة الميكروية للأغشية باستخدام جهاز القساوة الميكروية المزود بهرم ماسي ذي زاوية 136°، وذلك لقياس قساوة فيكرز الميكروية للغشاء

# 3-النتائج والمناقشة:

الموضَّع.

## 3-1 حساب ثخانة الغشاء:

حُسبت ثخانة الغشاء الرقيق pp-HMDSO الموضع على ركائز من التيتانيوم Ti بطريقة توضيع البخار الكيميائي المعزز بالبلازما (PECVD)، وبتطبيق شروط التوضيع السابقة نفسها على المقياس الميكروي البلورة الكوارتز Quartz crystal microbalance QCM مراقبة عملية التوضيع الشكل (3)، حيث كان Saurbrey أول من اقترح استخدام حساب ثخانة الغشاء الموضع، وذلك من خلال علاقته:

$$d_{f} = \frac{N_{q}\rho_{q}}{\rho_{f}f_{0}^{2}}\Delta f \tag{1}$$

#### حيث:

d<sub>f</sub>: ثخانة الغشاء الرقيق.

(Au التجاوبي لبلورة الكوارنز المطلية بالذهب  $f_0$  التواتر التجاوبي لبلورة الكوارنز  $f_0$ 

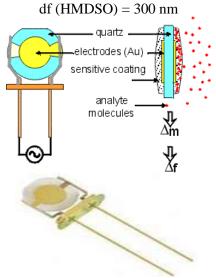
 $(2.65 \text{ g cm}^{-3})$  کثافة الکوارنز ( $\rho_{q}$ 

 $N_{\rm o}$ : ثابت اهتزاز الكوارنز  $N_{\rm o}$ : ثابت اهتزاز الكوارنز

ρ<sub>f</sub>: كثافة المادة المراد توضيعها.

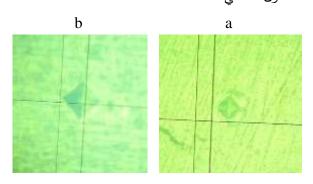
Δf: تغيّر تواتر الاهتزاز لبلورة الكوارتز.

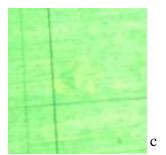
HMDSO نساوي كثافة الغشاء الموضع بلازمياً من 1.8 g/cm³ تقريباً  $8.8 \, \text{g/cm}$  وذلك حسب دراسة كلٍ من S. Saloum وآخرين [16]، ومن تعويض القيم جميعها بالعلاقة السابقة باعتبار أن قيمة  $4.4 \, \text{HMDSO}$  :  $4.4 \, \text{HMDSO}$  :



الشكل (3) المقياس المكروي لبلورة الكوارتز Quartz crystal microbalance QCM القساوة الميكروية:

تم قياس القساوة الميكروية لركائز من التيتانيوم Ti بطريقة فيكزر، وذلك عند حمولة  $25~g_f$  وزمن تطبيق للحمل قدره 15s وقياس بعدي أثر الهرم المطبوع على الركيزة والموضحة بالشكل (4)، إذ جرى قياس القساوة الميكروية لكل من الركائز الموضّع عليها الغشاء ومثيلاتها المرجعية، وتلك الموضع عليها الغشاء بعد وضعها في المحلول الملحى.





الشكل (4) أثر الهرم المطبوع a) على الركائز الموضَع عليها الغشاء d) على الركائز المرجعية c) على الركائز الموضَع عليها الغشاء بعد وضعها في المحلول الملحي.

بينت النتائج الموضحة في الجدول (1) قيم القساوة الميكروية المقاسة للركائز المذكورة سابقاً، حيث أجريت ثلاث قياسات لكل ركازة، وتم حساب المتوسط الحسابي وكانت قيمة القساوة الميكروية للغشاء الموضع بلازمياً من السليكون العضوي HMDSO تساوي 427.6HV أي أن للركائز المرجعية كانت قساوتها 427.6HV أي أن قساوتها الميكروية قد ازدادت بمقدار مرة ونصف تقريباً.

الجدول(1) قيم القساوة الميكروية المقاسة

Ti/HDMSO***	Ti/HDMSO**	Ti*	العينة
TI/IIDMSO	TI/TIDIVISO	11	
626 <b>.8</b>	645.9	434.7	القساوة
569.9	595.8	418.7	HV
595.4	570	429.4	
<b>5</b> 97.4	603.9	427.6	المتوسط الحسابي
397.4	003.9	427.0	الحسابي

<sup>\*</sup> القساوة الميكروية لركائز Ti.

\*\* القساوة الميكروية المركبة لركائز Ti الموضع عليها HMDSO

\*\*\* القساوة الميكروية المركبة لركائز Ti الموضع عليها HMDSO بعد وضعها في محلول 0.9%NaCl

أما قيمة القساوة الميكروية للركائز بعد وضعها في المحلول الملحي 0.9% NaCl لمدة عشرة أيام بدرجة حرارة الغرفة فكانت 597.4HV.

وتعطى نسبة تدهور الغشاء في هذا الوسط من العلاقة [7]:

$$DR(\%) = \left(1 - \frac{HV^s}{HV^0}\right) \times 100 \tag{2}$$

حيث:

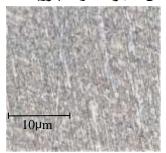
 ${
m HV}^0$  القساوة المقاسة للغشاء pp-HMDSO الموضّع على ركازة Ti .

HV° القساوة المقاسة لركائز Ti المطلية بعد غمرها لمدة عشرة أيام في المحلول الملحى.

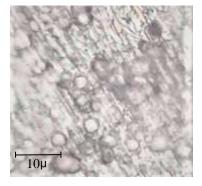
من التعويض في العلاقة السابقة نجد أن قيمة التدهور لهذه الأغشية تساوى %1 فقط.

# 3-2 تحليل المورفولوجية السطح:

يُظهر الشكل (5) الصور المجهرية الضوئية للأغشية الرقيقة pp-HMDSO الموضعة على ركائز من Ti، بينما يبين الشكل (6) سطح هذا الغشاء بعد وضعه لمدة عشرة يبين الشكل (6) سطح هذا الغشاء بعد وضعه لمدة عشرة أيام في محلول فيزيولوجيNaCl % 0.9. تتمتع النقور المتشكلة على السطح بأشكال غير منتظمة وبأحجام تتراوح بين mسطح (2µm)، وتم تقدير نسبة توزع النقور على السطح (كمؤشر على تدهور الأغشية الرقيقة من السليكون العضوي pp-HMDSO بسبب مهاجمة الأوساط المخرشة) باستخدام برنامج "Gwyddion" فكانت %1 في المحلول المذكور سابقاً، مما يعطينا فكرة واضحة عن عمر الغشاء الرقيق في هذا الوسط، وهذا يؤكد النتائج التي استُتجت من اختبار القساوة الميكروية المناقشة سابقاً.

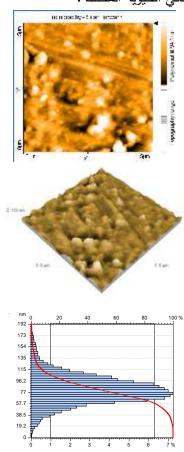


الشكل (5) صورة المجهر الضوئي للأغشية الرقيقة pp-HMDSO الموضّعة على ركائز التيتانيوم.

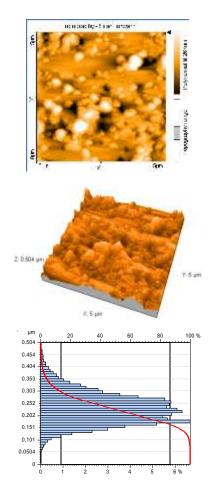


الشكل (6) صورة المجهر الضوئي للأغشية الرقيقة pp-HMDSO الموضَّعة على ركائز التيتانيوم بعد وضعها لمدة عشرة أيام في المحلول الفيزيولوجي NaCl % 0.9 %

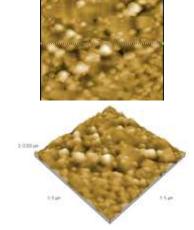
استُخدم مجهر القوة الذرية (AFM) من أجل رسم تضاريس السطوح للركائز Microscope من التيتانيوم Ti الموضّع عليها السليكون العضوي، ومثيلاتها المرجعية، إضافة إلى الركائز الموضوعة في المحلول الفيزيولوجي. توضح الأشكال (7) و (8) و (9) موروفولوجية السطح للعينات المذكورة أنفاً بأبعاد (5×5µm²)، حيث لوحظ أن عملية التوضيع التي نفذت على ركائز التيتانيوم Ti قد جعلت من السطح ذي خشونة معتدلة بالنسبة الى سطح الركائز المرجعية، مما يدل على زيادة قدرة ارتباطها في أماكن الزرع ومن ناحية أخرى سليكونيه عضوية، ولذلك ينصح بتطبيقها لتغليف الزرعات سلطيية المعدني الحيوية المختلفة.



الشكل (7) صورة مجهر القوى الذرية (AFM) للعينات المرجعية لمعدن التيتانيوم Ti



الشكل (8) صورة مجهر القوى الذرية (AFM) لركائز من التيتانيوم Ti الموضع عليها سليكون العضوى HMDSO



الشكل (9) صورة مجهر القوى الذرية (AFM) لركائز من التيتانيوم Ti المغلّفة بالسليكون العضوي HMDSO الموضوعة في المحلول الفيزيولوجي.

يوضح الجدول (4) قيم الخشونة السطحية لكلٍ من العينات المرجعية، وتلك الموضع عليها السليكون العضوي HMDSO وثالثة الموضوعة في المحلول المذكور آنفاً.

الجدول(4) قيم الخشونة السطحية

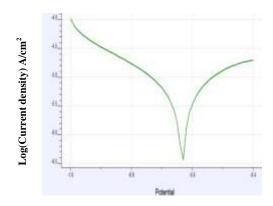
Sample	Roughness (RMS) (nm)
الركائز من التيتانيوم <b>Ti</b>	113
الركائز من التيتانيوم Ti الموضع عليها سليكون العضوي HMDSO	504
الركائز المغلّفة بالسليكون العضوي HMDSO	323
الموضوعة في المحلول الفيزيولوجي	

#### 3-3 التوصيف الكهروكيميائي:

أجريت قياسات الاستقطاب في خلية كهروليتة تقليدية Cell-4EL بثلاثة إلكترودات الشكل (c−2)، حيث استخدم فيها إلكترود الكالومل المشبع (SCE) والكترود بلاتين كإلكترود مرجعي ومساعد على الترتيب. يتمتع إلكترود العمل بشكل اسطواني بمساحة سطحية للمقطع 200~mV/s العامل تساوي  $0.7~\text{cm}^2$ ، وكان معدل المسح في المجال الواقع بين القيمتين [-1000, -400 mV] وبخطوة 10mV. سُمح بزمن استقرار 30 دقيقة قبل تسجيل كل منحنى. تبين الأشكل(8) و(9) و(10) منحنيات الاستقطاب تافل للتيتانيوم Ti العاري والمطلى بـ pp-HMDSO وذلك بعد غمرهما في محلول %0.9 المقارنة فيما بينها وذلك على الترتيب NaCl ( $p^H=5$ ) ولمدة عشرة أيام في درجة حرارة C 25°C. يمكن تحديد كل  $(R_p)$  ومقاومة الاستقطاب ( $I_{corr}$ ) ومقاومة الاستقطاب باستخدام برنامج "IviumSoft". ومن الممكن أيضاً تقدير نسبة الحماية  $(P_i(\%))$  باستخدام المعادلة [16-15]:

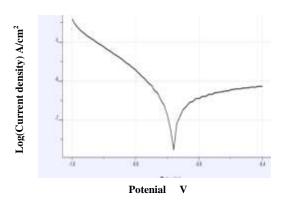
$$P_i(\%) = \left(1 - \frac{i_{corr}}{i_{corr}^0}\right) \times 100 \tag{3}$$

حيث $i_{corr}$  و  $i_{corr}^0$  هما كثافة تيار التآكل للفولاذ المطلي ب pp-HMDSO والفولاذ العارى بالترتيب.

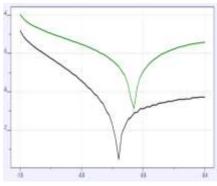


Potenial V

Ti الشكل (8) اختبار استقطاب تافل لتحليل معدل التآكل للتيتانيوم في محلول 0.9% NaCl في محلول



Ti الشكل (9) اختبار استقطاب تافل لتحليل معدل التآكل للتيتانيوم الموضَّع عليه سليكون عضوي pp-HMDSO



الشكل (10) مقارنة منحنيي الاستقطاب تافل لتحليل معدل التآكل HMDSO للتيتانيوم Ti العاري و الموضَّع عليه سليكون العضوي 0.9% NaCl بعد وضعها في محلول الم

ويوضح الجدولان (5) و (6) كلاً من قيم كمون التآكل ويوضح الجدولان  $i_{corr}$  ومعدل  $E_{corr}$  التآكل C.Rate التآكل

الجدول (5) قيم معدل التآكل المستنتجة من برنامج IviumSoft لتحلول المحلول TyiumSoft مرجعية بعد وضعها في المحلول

	Pol. Res.	Tafel data	Model data
E <sub>corr</sub> (V)	-0.6342	-0.6212	-0.6361
i <sub>corr</sub> (A)	4.983E-06	5.012E-06	9.741E-06
$I_{corr} (A/cm^2)$	3.322E-06	3.341E-06	6.494E-06
Rp (Ω)	1.003E04	1.376E04	1.088E04
C.Rate(mm/y)	0.03858	0.03881	0.07543

الجدول (6) قيم معدل التآكل المستنتجة من برنامج IviumSoft لعينة Ti/HDSMO بعد وضعها في المحلول

	Pol. Res.	Tafel data	Model data
$\mathbf{E_{corr}}$ (V)	-0.6676	-0.6620	-0.6808
i <sub>corr</sub> (A)	3.826E-07	3.078E-07	6.45E-07
I <sub>corr</sub> (A/cm <sup>2</sup> )	2.55E-07	2.052E-07	4.3E-07
Rp (Ω)	1.307E05	1.877E05	1.339E05
C.Rate(mm/y)	0.007794	0.01012	2.441E-08

وتكون قيمة الحماية حسب العلاقة (3):

$$P_i(\%) = \left(1 - \frac{3.078E - 07}{5.012E - 06}\right) \times 100$$

$$P_i(\%) = 94\%$$

### 4- الاستنتاجات الممكنة من البحث:

- 1) وُظفت تقنية توضيع البخار الكيميائي المعزز بالبلازما (PECVD) لتحضير أغشية رقيقة من مادة السليكون العضوي HMDSO على كلٍ من ركائز معدن التيتانيوم Ti ومثيلاتها من الكوارتز (QCM) وثالثة من السليكون.
- 2) نُوقشت نتائج خواص هذا الغشاء من حيث زيادة مقاومته التأكل، وذلك بالنسبة لأغشية السليكون العضوي الموضّعة على ركائز من التيتانيوم Ti/HMDSO HMDSO ومثيلاتها المرجعية، حيث بينت هذه الدراسة أن مقاومة التآكل لأغشية وسط فيزيولوجي، الموضَّعة على التيتانيوم Ti في وسط فيزيولوجي، تتمتع بمقاومة تآكل أعلى مقارنة مع ركائز معدن التيتانيوم Ti نفسها، إذ وُجد تحسن واضح وكبير من ناحية مقاومة التآكل حيث ازدادت هذه المقاومة من ناحية مقاومة التآكل حيث ازدادت هذه المقاومة من أن تيار التآكل قد انخفضت قيمته من 1.877×10.5)، ولوحظ أن تيار التآكل قد انخفضت قيمته من 1.877×10.5)، ويتعلق هذا بتغطية العيوب السطحية وتشكل طبقة واقية مقاومة للتآكل، وتكون قيمة الحماية المتعلقة بتوضيع هذا الغشاء تساوي 94%.

- (2) أوضحت هذه الدراسة ازدياد قيم القساوة الميكروية بشكل ملحوظ، حيث كانت قيمتها (427.6HV) للتيتانيوم Ti أما قيمتها من أجل البنية المركبة Ti/HMDSO لأغشية من السليكون العضوي HMDSO والموضعة بطريقة البخار الكيميائي المعزز بالبلازما (PECVD) ازدادت الى المحلول (603.9HV)، وإن قيمة التدهور لهذه الأغشية تساوى %1 فقط.
- 4) تؤدي الخواص السطحية للمواد المعدنية الطبية الحيوية دوراً مهماً وكبيراً في تحديد الاستجابة الخلوية (التصاق الخلايا وانتشارها على سطح هذه المعادن)، وبالتالي توافقها الحيوي، حيث تمكن البنية المجهرية لسطح التيتانيوم الموضع عليه سليكون عضوي HMDSO والمستنتجة من مجهر القوة الذرية AFM القدرة على تحقيق التصاق خلوي عالي وإحداث تولد الأوعية على السطح، وبالتالي تحسن في عملية الاندماج العظمي. إذ ارتفعت قيم الخشونة السطحية من mm 113 إلى 113 سم 504، وهذا يؤدي بدوره الى زيادة التماسك العظمي من جهة، إضافة الى ديمومة الزرعات لأكثر من 15 سنة من جهة أخرى، وانطلاقاً من هذه النتائج يمكن استخدام هذه الزرعات في التعويضات السنية والمفاصل بين العظام لتحقيقها أكبر قوة ترابط وتوافقية مع العظام وسوائل جسم الإنسان.
- أنتيجةً لزيادة مقاومة التآكل، وخاصة ضمن الأوساط المشابهة للأوساط الفيزيولوجية وزيادة القساوة السطحية، وتحسين المولوفورجية السطحية للمواد المعدنية الموضع عليها السليكون العضوي، فإن توضيع أغشية من هذه المادة يؤدي إلى زيادة المواءمة الحيوية، وبالتالي تقبل الجسم للزرعات المصنعة من النيتانيوم الموضع عليه هذه الأغشية.

## مسرد المصطلحات:

- Organosilicon: السليكون العضوي
- pp-HMDSO: سداسي ميثيل ديسيلوكسان المتبلمرة بلازمياً.
- (PECVD) : توضيع البخار الكيميائي المعزز بالبلازما

(Å)	• a,b,c: أبعاد الخلية الاولية	Quartz Crys مجاوب	stal Microbalance (QCM) •
` ,			بلورة الكوارتز
(V)	$ullet$ کمون التآکل: ${ m E}_{ m corr}$	اء التجربة (mbar)	<ul> <li>الضغط الأولي والضغط أثتا</li> </ul>
(A)	التآكل: لوغاريتم تيار التآكل $i_{ m corr}$	$(f_0=6.0 \text{ MHz})$	• f <sub>0</sub> : التواتر التجاوبي لبلورة ما
(Ohm)	• Rp: مقاومة التآكل		و و $ ho_{ m q}$ . كثافة الكوارتز $ ho_{ m q}$
(mm/y)	• C. Rate: معدل التآكل		•
5 % % % 1 1	التمويل: هذا البحث ممول من ج	•	$ ho_{ m q}$ : ثابت اهتزاز الکوارنز $ ho_{ m q}$
امعه دمسق وقق رقم		شاء (cm²)	<ul> <li>A: مساحة البلورة المطلية بالغ</li> </ul>
	التمويل (501100020595).	(nm)	$ullet$ ثخانة الغشاء الرقيق: ${ m d_f}$
		$(g/cm^3)$	• p <sub>f</sub> : كثافة المادة المراد ترسيبها

#### Reference

- 1. Wrobel A.M and Wertheimer M.R, Plasma-polymerized organosilicones and organometallics Plasma Deposition, Treatment, and Etching of Polymers ed R d'Agostino (London: Academic), 1990, p.163
- 2. Zajickova L,Bursikova V,Janca J.Proceedings of the ICCP and 25th EPS Conference, Praha, Czech Republic, 22C, 1998, p. 2781.
- 3. Gaur S, Vergason G, Society of Vacuum Coaters, 43rd Annual Technical Conference Proceedings-Denver, April 15-20, 2000, p.267.
- 4. Cremona A, et al. J.Appl.Phys. 2005; 97: 023533.
- 5. Lieberman M.A, Lichtenberg A.J, Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Wiley, New York, 1994.
- 6. Bonizzoni G, Vassallo E, Vacuum 2002;64: 327.
- 7. Gerrit Wulf. Bernd Mayer. Uwe Lommatzsch. Published: 4 January 2022 "Plasma Co-Polymerization of HMDSO and Limonene with an Atmospheric Pressure Plasma Jet". Plasma 2022, 5(1), 44-59.
- 8. S. Saloum, B. Alkhaled, W. Alsadat, M. Kakhia, S.A Shaker, 2018 "Plasma polyerized hexamethyldisiloxane thin films for corrosion protection". Modern Physics Letters B. Vol. 32, No. 03.
- 9. S. Saloum, M. Naddaf and B. Alkhaled, "Plasma polymerized Hexamethyldisiloxane thin films for corrosion protection" Vacuum 82 (2008) 742.
- 10.T. R. Gengenbach and H. J. Griesser, Polymer 40 (1999) 5079.
- 11. Y.-M. Ko, H.-C. Choe, S.-C. Jung and B.-H. Kim, Prog. Org. Coat. 76 (2013) 1827.
- 12.D. B. T. Mascagni et al., Mater. Res. 17 (2014) 1449.
- 13.H. M. Abourayana, N. A. Zreiba and A. M. Elamin, Int. J. Chem. Mol. Nucl. Mater. Metall. Eng. 5 (2011) 117.
- 14.E. Angelini, R. d'Agostino, F. Fracassi, S. Grassini and F. Rosalbino, Surf. Interface Anal. 34 (2002) 155.
- 15. Saurbrey G. Z Phys 1959; 155: 206.
- 16.S Saloum, S Abou Shaker, M.Nidal Alkafri, Asmhan Obaid, Rokayya Hussin. Effect of surface modification on the properties of plasma-polymerized hexamethyldisiloxane thin films. Surf Interface Anal. 2019;51:754–762.
- 17.S.-M. Yang, Y.-Y. Chang, D.-Y Wang, D.-Y Lin and W. Wu, J. Alloys Compd. 440 (2008) 375.
- 18.K. Nozawa and K. Aramaki, Corros. Sci. 41 (1999) 57.